

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成26年11月13日(2014.11.13)

【公開番号】特開2013-105948(P2013-105948A)

【公開日】平成25年5月30日(2013.5.30)

【年通号数】公開・登録公報2013-027

【出願番号】特願2011-249775(P2011-249775)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/205 (2006.01)

H 0 1 L 21/22 (2006.01)

C 2 3 C 16/44 (2006.01)

C 2 3 C 16/455 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/205

H 0 1 L 21/22 5 1 1 Q

C 2 3 C 16/44 J

C 2 3 C 16/455

【手続補正書】

【提出日】平成26年9月26日(2014.9.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板を処理する処理室と、

前記基板を保持し、前記処理室内外に搬送される基板保持具と、

前記基板保持具への前記基板の装填、又は前記基板保持具からの前記基板の脱装が行われる移載室と、

前記移載室内の前記基板保持具に、不活性ガスを噴射するノズルを備える不活性ガス供給機構と、

前記処理室内から前記移載室内に搬出されて前記基板が脱装された前記基板保持具に、前記ノズルから不活性ガスを噴射するように前記不活性ガス供給機構を制御する制御部と、
を備え、

前記ノズルは、上方から下方に向かって角度をつけて不活性ガスを噴射することを特徴とする基板処理装置。

【請求項2】

前記基板保持具は回転機構を備え、

前記制御部は、少なくとも前記ノズルから不活性ガスが噴射されている間、前記移載室内で前記基板保持具を回転させるように前記回転機構を制御する請求項1に記載の基板処理装置。

【請求項3】

前記基板処理装置は、前記移載の雰囲気中の異物濃度を測定する異物測定機構を備え、

前記制御部は、前記異物測定機構により測定した異物濃度が所定の値以下となったときに、前記移載室内への不活性ガスの供給を停止する様に、前記不活性ガス供給機構を制御する請求項1または2に記載の基板処理装置。

【請求項4】

前記移載室の前記ノズルと対向する位置には、前記ノズルから噴射される不活性ガスにより吹き飛ばされた異物を収集する仕切部が設けられる請求項 1 から 3 のいずれか 1 つに記載の基板処理装置。

【請求項 5】

移載室内で基板保持具に基板を装填し、前記基板保持具を前記移載室内から処理室内に搬入する工程と、

前記処理室内で前記基板を処理する工程と、

前記基板保持具を前記処理室内から前記移載室内に搬出し、前記基板保持具から処理後の前記基板を脱装する工程と、

前記移載室内に設けられた不活性ガス供給機構が備えるノズルから、前記基板が脱装された前記基板保持具に、上方から下方に向かって角度をつけて不活性ガスを噴射する工程と、を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。